

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成20年6月26日 (2008.6.26)

【公開番号】特開2002-107287(P2002-107287A)

【公開日】平成14年4月10日 (2002.4.10)

【出願番号】特願2001-194838(P2001-194838)

【国際特許分類】

G 0 1 N 15/14 (2006.01)

G 0 1 N 33/48 (2006.01)

G 0 1 N 33/49 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 15/14 K

G 0 1 N 15/14 C

G 0 1 N 33/48 M

G 0 1 N 33/49 E

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月16日 (2008.4.16)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の粒子を含む試料から各粒子ごとに粒子の特徴を表す少なくとも 2 種類のパラメータを検出する検出部と、

前記検出部で検出されたパラメータを処理する処理部と、

前記処理部による処理結果を出力する出力部を備えた粒子分析装置であって、前記処理部は検出されたパラメータに基づいて粒子のスキッタグラムを作成する分布図作成部と

、作成されたスキッタグラム中に予め所定の粒子分布領域を設定する領域設定部と、

設定された粒子分布領域の粒子分布状態に対応する分画線を算出し、算出した分画線によってスキッタグラム上の粒子を分画する分画部を備えた粒子分析装置。

【請求項 2】

前記分画部は、設定された粒子分布領域内に分布する粒子の分散共分散行列 を求め、そこから の固有ベクトル及び の固有値を求め、さらに の固有ベクトルと の固有値から分画線を算出する請求項 1 に記載の粒子分析装置。

【請求項 3】

前記分画線が分画用放物線である請求項 1 に記載の粒子分析装置。

【請求項 4】

前記分画線が分画用放物線であり、前記分画部は、 の固有ベクトルから放物線の傾きを、 の固有値から放物線の広がり度合いを求めて分画用放物線を算出する請求項 2 に記載の粒子分析装置。

【請求項 5】

複数の粒子を含む試料から各粒子ごとに粒子の特徴を表す少なくとも 2 種類のパラメータを検出し、検出されたパラメータに基づいてスキッタグラムを作成し、スキッタグラム中に予め設定した粒子分布領域内に分布する粒子の分散共分散行列 を求め、そこから の固有ベクトル及び の固有値を求め、さらに の固有ベクトルと の固有値から

分側線を算出し、算出した分側線によってスカッタグラム上の粒子を分画する工程からなる粒子分画方法。

【請求項6】

前記分画線が分画用放物線であり、 θ の固有ベクトルから求めた放物線の傾きと θ の固有値から求めた放物線の広がりの度合いとから分画用放物線を算出する請求項5に記載の粒子分画方法。